

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年8月3日(2006.8.3)

【公開番号】特開2002-31706(P2002-31706A)

【公開日】平成14年1月31日(2002.1.31)

【出願番号】特願2000-216151(P2000-216151)

【国際特許分類】

**G 02 B 5/08 (2006.01)**

**G 02 B 5/02 (2006.01)**

**G 02 F 1/1335 (2006.01)**

【F I】

G 02 B 5/08 B

G 02 B 5/08 E

G 02 B 5/02 C

G 02 F 1/1335 5 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月16日(2006.6.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

この視野角を広げるためには反射体の反射特性（光の集中と分散）を制御することが必要であり、これまで多くの検討がなされてきた。反射体の反射特性を制御する方法としては、反射面（金属薄膜層）を形成する基材（高分子フィルム）を凹凸化する方法が一般的である。凹凸化方法としては、

(1) 高分子フィルム表面にエンボス加工を施し凹凸構造を形成した後、表面を溶剤で処理して滑らかにする方法。

(2) 高分子フィルム表面にSiO<sub>2</sub>などの粒子を高圧空気とともに吹き付けるサンドブラスト方法。

(3) エッティング法などの化学的方法。

などが挙げられる。しかしながら、(1)、(2)の方式では、機械的物理的方法によりフィルム表面に凹凸形状を形成する方式のため、フィルムの材質の選択のはばが狭くまた、厚みもある程度厚くしなければならないという欠点がある。また、(2)の方法では硬いサンド(SiO<sub>2</sub>)の形状が不均一なことから、得られる凹凸形状も激しくかつ、不均一に荒れており、アルカリ溶液処理などで表面の一部を溶解しても、この荒れを十分に均一化することができず、えられる凹凸構造が非常に不均一になるという欠点がある。さらにまた、(3)のような化学的方法においても、フィルムの材質の選択がシビアでありまた、処理後の洗浄乾燥が大変であるという欠点がある。